PASJ2019 FRPI047

# ビーム・プラズマシミュレーションにおける粒子発生の取り扱い PARTICLE EMISSION IN CHAGED PARTICLE DYNAMICS SIMULATION

菅野浩一<sup>#</sup> Koichi Kanno<sup>#</sup> AET, Inc.

## Abstract

Numerical simulations enable us to understand complicated particle beam dynamics and plasma properties. These simulations require an accurate model of charged particle generation by different physical processes. This paper reviews the physical processes and the latest charged particle dynamics simulations for emissions from solid surface and neutral gases.

#### 1. はじめに

荷電粒子はさまざまな機構によって空間中に放出され る。その機構を理解し制御することで荷電粒子ビームや プラズマを用いた先端的な装置が開発されてきた。ビー ム・プラズマ装置の発展は学術研究から産業や医療に いたる広範囲かつ高度なニーズに対応してきたが、その 技術的要求はさらに高まっている。それに伴い、今まで 以上に実際的なシミュレーションが期待されるようになっ ている。荷電粒子シミュレーションにおいては、粒子発生 の機構を正しく取り扱い、モデルとして組み込むことは重 要である。また、シミュレーションを行う際にもその機構の 理解が必要となる。本発表では、荷電粒子シミュレーショ ンにおける粒子発生の取り扱いと実際の粒子放出機構 を述べ、シミュレーション例を挙げる。ただし、対象とする 応用範囲はソフトウェアで異なり、各機能の実装状況は それぞれで異なる。また、プラズマに関しては粒子モデ ルを前提とし、流体モデルを用いる方法は想定しないこ ととする。

# 2. シミュレーションにおける粒子設定

荷電粒子シミュレーションでは、対象となる粒子種(電 荷と質量)の選択とビームまたはプラズマとしての特性を 設定する必要がある。この際、ある所定の値や特性を与 えるか、粒子放出を支配する物理現象を説明する放出 機構によるモデルから決められることになる。ただし、 ビームやプラズマ中には膨大な数の荷電粒子があり、そ のすべてを計算することは現在でも非現実的である。そ のため複数の荷電粒子をマクロ粒子と呼ぶひとつの計 算粒子で表現する。多数ではあるが実際の粒子よりは少 なく、計算上現実的な個数のマクロ粒子に関して運動方 程式を解いて位置や速度(もしくは運動量)を計算し、電 荷密度や電流密度、電磁場分布などを得る。マクロ粒子 の電荷は、ビームでは放出電流や放出電流密度、バン チ当たりの電荷、プラズマではその密度を与えることで 決まる。初期条件として位置と速度の指定も必要である。 ただし、必ずしもすべての粒子が同じ速度を持つわけで はなく、分布を持つことが考えられため、各座標成分に 対し平均速度と熱速度で与える場合もある。ビームライン

設計を意識したソフトウェアではエミッタンスの指定も通 常可能となっている。また、すべてのマクロ粒子の情報を テキストデータとして記述し、それを読み込む機能も多く のソフトウェアで組み込まれている。このような粒子の任 意設定は、ビームやプラズマの素性がわかっている場合 に使うだけでなく、ある仮定に対する条件においてどの ような現象が起きうるかの予測にも使うことができ、シミュ レーションに期待される重要な役割のひとつとして大きな 意義がある。

シミュレーションにおける粒子設定は上記の内容でほ ぼ揃うが、低エネルギー粒子や大電流密度ビームは荷 電粒子の電荷による反発力の影響が大きい。固体表面 からの粒子放出では、その反発力によって放出電流密 度 Jsclが制限される空間電荷制限領域と呼ばれる状態に なり、Child-Langmuirの式

$$J_{scl} = \frac{4\,\varepsilon_0}{9} \left(\frac{2q}{m}\right)^{1/2} \frac{V^{3/2}}{d^2} \tag{1}$$

で表される。この式は2枚の電極で構成された平行平板 を仮定しており、 $\epsilon_0$ は真空の誘電率、qは荷電粒子の電 荷は、mは質量、Vは電極間の電位差、dは電極間距離 である。粒子源として規定されている放出電流密度を Jemitter とすると、Jemitter よりも Jscl が小さいときにこの領域と なる。Jemitter は次章で述べる発生機構によって決まる。 Equation. (1)からわかるように、空間電荷制限領域での 放出電流は引き出し電圧に依存する。つまり、この領域 では、粒子源が持つ最大の粒子放出能力は得られず、 引き出し電圧もしくは放出面の電界によって制限されて しまう。空間電荷を無視できるような低電流ビームなどの 場合を除けば、当然ながら荷電粒子シミュレーションで は電荷を考慮してその運動解析を行うので、シミュレー ション結果にもこのような電荷による粒子放出の制限が 現れる。粒子運動解析の手法によっては、Eq. (1)を組み 込んだ粒子放出モデルを使用してシミュレーションを行う 必要がある。このため、荷電粒子放出を取り扱う議論で は、実際の装置内で起こる現象においてもシミュレーショ ン上での粒子の挙動であっても、空間電荷制限領域に あるか否かを把握しておくことは大切である。

<sup>#</sup> kanno@aetjapan.com

## PASJ2019 FRPI047

## 3. 粒子発生機構

#### 3.1 固体表面からの放出

空間電荷制限領域ではない場合、固体表面からの電子放出は、固体内部にある電子へどのように仕事関数 以上のエネルギーを与えたかで決まる。

熱電子放出は最も一般的でタングステンや LaB<sub>6</sub>、含 浸型など多様な種類があるが、その放出電流密度 *J*<sub>therm</sub> は温度に依存し、Richardson-Dushman の式

$$J_{therm} = \frac{4\pi m e k^2}{h^3} T^2 exp\left(-\frac{\phi}{kT}\right)$$
(2)

で表される。ここで e は電気素量、k はボルツマン定数、 h はプランク定数、 Øは仕事関数、T は温度を示す。 Equation. (2)に支配される領域にあるときは、空間電荷 制限領域に対して温度制限領域と呼ばれる。

光電子放出は、入射光子数に対する放出電子の数で 決まる量子効率ηで電子の放出しやすさが示され、以下 の式で表すことができる。

$$\eta = \frac{hc \ Q[nC]}{100e \ \lambda[\mu m] \ W[\mu J]} \tag{3}$$

ここで、*c*は光速、*Q*は電子の放出電荷量、*λ*は入射光の 波長、*W*は入射光のエネルギーである。レーザー励起の 高輝度電子源で適用されているが、電子放出電荷*Q*は 照射レーザー入射角、波長、仕事関数、陰極温度、印 加電場、表面状態などに依存する。

二次電子放出において、一次粒子が電子の場合では 入射電子によって固体内から弾き出される真の二次電 子だけではなく、一次電子の後方散乱と再拡散も含まれ る。この詳細モデルとアルゴリズムは Furman と Pivi に よって開発されている[1]。また、真の二次電子のみを考 慮するモデルを適用することもある[2]。

電界電子放出は、固体表面に高電界を印可することで起きるトンネル効果によってポテンシャル障壁を超えた電子の放出であり、電界電子放出の電流密度 *J<sub>field</sub>* は Fowler-Nordheim の式

$$J_{field} = \frac{e^3}{8\pi h} \frac{E^2}{\phi} exp\left(-\frac{8\pi\sqrt{2m}}{3he} \frac{\phi^{3/2}}{E}\right)$$
(4)

で表される。ここで E は電界である。カーボンナノチュー ブ(CNT)に注目が集まりがちだが、ニードル型も使用さ れており、また Spindt タイプで知られるようなアレイ状の チップ型電子源への期待も高い[3]。

イオンに関しても表面効果による固体表面からの放出 が考えられるが、表面近傍の原子や分子のイオン化を通 常考える。表面電離型や強電界印可型などのイオン源 がある。また、イオン衝撃で固体原子を弾き出すスパッタ リングも関心の高い現象であり、Yamamura のモデル[4] などに基づいて記述されることがある。

実際の固体表面からの粒子放出特性は、表面状態や 真空の質などの影響を受け、期待した電流が得られない ことやトラブルの原因となり得る不要な粒子放出を起こす ことがあり、シミュレーションの設定にも注意が必要である。

#### 3.2 気体からの放出

気体からの粒子放出は、気体原子・分子の電離電圧 を超えるエネルギーを与えることで得られる。電離には、 粒子間の衝突による衝突電離や光子のエネルギーを吸 収することによる光電離、気体原子・分子の運動エネル ギーが電離エネルギー以上になることによる熱電離が考 えられる。電荷交換や電子付着などの粒子衝突反応に よっても荷電粒子の生成と消滅が起きており、粒子放出 を起こす現象として考慮する必要がある。また、励起や 弾性散乱のような荷電粒子の生成と消滅が起きない粒 子衝突反応に関しても荷電粒子シミュレーションにおい て無視できない物理現象である。以下にVSim[5]で考慮 できる衝突反応の一例を示す。

衝突電離	$A + B \rightarrow A + B^+ + e^-$
電子衝突電離	$A + e^- \rightarrow A^+ + 2e^-$
電荷交換	$A^+ + B \rightarrow A + B^+$
電子付着	$e^- + A \rightarrow A^-$
解離性電離	$AB + e^- \rightarrow A^+ + B + 2e^-$
	$AB + e^- \rightarrow A^+ + B^+ + 3e^-$
電界電離	$A + E$ -field $\rightarrow A^+ + e^-$
再結合	$A^+ + e^- \rightarrow A$
三体再結合	$A^- + e^- \rightarrow A + 2e^-$
解離性再結合	$AB^+ + e^- \rightarrow A + B$

粒子衝突の計算には、粒子と中性粒子の両方をマクロ粒子で表現する Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) 法や気体中の中性粒子を流体として仮定する Monte Carlo Collision (MCC) 法[6]が使用される。粒子衝突反応の起こりやすさは衝突断面積で議論され、衝突エネル ギーに依存する。シミュレーションにおいてはこの衝突断面積を与える必要がある。

実際のプラズマの生成や放電は宇宙線などの自然放 射線による気体の自然電離や装置内の構造表面からの 電子放出が前駆となる。その過程で生じた電子が、電場 によって加速されて高エネルギーとなり衝突電離を起こ す。その結果、電子とイオンが雪崩的に増加して最終的 にプラズマや放電にいたる。シミュレーションでは、ある 程度電離が進んで低密度のプラズマになった状態から 開始し、定常状態になるまで計算を続けることが多い。た だし、プラズマや放電の維持には粒子衝突過程だけで なく、直流電圧やマイクロ波・RF などの供給電力の条件 も関係し、さらにイオンによる二次電子放出(タウンゼント の理論におけるγ作用)などが複雑に関係している。その ため、シミュレーションは気体中の粒子衝突反応だけで はなく、前節で述べた固体表面からの粒子放出なども含 む複合的な取り扱いが必要となる。

プラズマからイオンを引き出す気体放電型イオン源は 多種多様であるが、プラズマ密度で放出面の形状が変 わることに注意が必要となる。シミュレーションをする場合 は、イオン源プラズマのシミュレーションとあわせてイオン 引き出しシミュレーションを行うか、プラズマシースを解析 モデルに基づいて計算する必要がある。後者の手法は IGUN[7]などいくつかのソフトウェアで適用されている。

# PASJ2019 FRPI047

# 4. シミュレーション例

# 4.1 固体表面からの放出(電子銃)

熱陰極電子銃では陰極温度で放出電流を制御できる が、三極管型としてグリッド電圧を用いたほうが制御性は 高い。三極管型電子銃の EGUN[7]による計算例を Fig. 1 に示す。加速電圧は 12 kV である。空間電荷制限領域 のため、放出電流はグリッド電圧に依存している。ただし、 いくらグリッド電圧を高くしても、実際には熱電子放出モ デルである Eq. (2)が決める性能 Jherm 以上には電流を得 られないことに注意が必要である。また、グリッド電圧が 変わったことでビーム軌道にも変化が表れている、これ はグリッドのレンズ効果と考えられる[8]。そのため電子銃 出口で得られるエミッタンスにも変化が現れる。空間電荷 の影響が少ない低電流ビームだとしても、グリッドの設計 のみならず動作電圧もビームの品質に影響を与えうると 考えられる。



Figure 1: Trajectories and equipotential lines for the triode electron gun.

# 4.2 固体表面からの放出(マルチパクタ放電)

マルチパクタ放電はマイクロ波・RF 電場とデバイスからの二次電子放出との同期によって電子数が指数関数的に増大して起こる真空放電である。従って、純粋なマルチパクタ放電の現象に対しては気体の電離現象を考慮せず、放電の前駆となる初期電子を配置する。860 MHz の信号を入力した単純な同軸伝送線路におけるマルチパクタ放電の VSim による計算結果を Fig.2 に示す。材質はステンレスを仮定し、伝送線路の中心付近にわず



Figure 2: Multipactor electron distribution at a frequency 860 MHz after 12.4 ns and 24.8 ns.

かな数の前駆電子を配置している。Figure.3 に示すよう に周波数が変わると、粒子数の推移も変わる。890 MHz では電子の増加がみられなくなり放電が起こらないこと が予想される。



Figure 3: The growth of the electrons due to multipacting.

# 4.3 気体からの放出(ビームによる気体の電離)

水素ガス雰囲気下(圧力 1.0 mTorr、温度 300K)に 50 keV、10 mA の陽子ビームを入射した VSim での計算結 果を Fig. 4 に示す。陽子が水素分子に衝突することで衝 突電離や電荷交換がおこり、電子や H<sub>2</sub>+が生成される。 衝突電離によって生じた電子が解離性電離(H<sub>2</sub> + e<sup>-</sup> → H<sup>+</sup> + H + 2e)を起こし、H が生成される。また、H<sub>2</sub>+と H<sub>2</sub>の 衝突によって H<sub>3</sub>+も生成される(H<sub>2</sub><sup>+</sup> + H<sub>2</sub> → H<sub>3</sub>+ H)。弾 性衝突も考慮しておりビームの散乱に寄与している。 Figure.5 には非弾性散乱の粒子衝突反応の衝突断面積 を示す。



Figure 4: Proton beam into a column of neutral  $H_2$  gas and scattered particles.



Figure 5: Cross sections for the collisions.

#### 4.4 気体からの放出(プラズマ)

軸対照構造を持つ容量性結合プラズマに関する VSim によるシミュレーションによって得られた電位分布 をFig. 6 に示す。この図では縦軸を半径方向、横軸を長 さ方向としている。図の上側と右側の電極は接地してい る。左側の電極は接地電極との間にギャップを設け、50 MHz、300Vの RF 電位を印加した。電極間に 1.0×10<sup>20</sup> 1/m<sup>3</sup> (約 3mTorr)のアルゴンガスが満たされているとして 設定した。この例では、中性ガスであるアルゴンと電子と の弾性衝突や衝突電離、励起が考慮されている。衝突 電離によって電極間のアルゴンイオンと電子の数が増え る。また、アルゴンイオンが電極に衝突することで得られ る二次電子も考慮されており、その電子がチャンバー内 に供給されていく。Fig. 7 に示すように 1 次元グラフによ るプラズマシースの評価も行った。



Figure 6: The electric potential inside the capacitively coupled plasma (CCP).



Figure 7: The sheath structure inside the capacitively coupled plasma (CCP).

## 5. まとめ

ビームやプラズマの発生、放電や暗電流の抑制のために、設計の最適化や改善を進め適切なパラメータを見い出すには、荷電粒子の放出機構を踏まえた考察が欠かせない。しかし、測定データによる粒子放出の直接的な考察は必ずしも容易ではない。装置内で起きている現象や反応は一つとは限らず、さらに装置の設計項目や運転パラメータは多数に及んでいる。荷電粒子シミュレーションはそういった複雑な動きをする粒子の挙動や電磁場との相互作用を視覚的に示すことができ、研究や開発、設計における複雑な現象の議論を支援する。

## 参考文献

- MA Furman and MTF Pivi. Probabilistic model for the simulation of secondary electron emission. Phys. Rev. ST Accel. Beams, 5:124404, 2002.
- [2] J. R. Vaughan. Secondary Emission Formulas. IEEE Transactions on Electron Devices, 40(4), 1993.
- [3] 真空ナノエレクトロニクス第 158 委員会、第 16 回真空ナ ノエレクトロニクスシンポジウム予稿集.
- [4] Y. Yamamura, H. Tawara, Atomic Data and Nuclear Data Tables Vol 62, "Energy Dependence of Ion-induced Sputtering Yields From Monatomic Solids at Normal Incidence" p. 149-253 (1996).
- [5] https://www.txcorp.com/
- [6] Birdsall C K 1991 Particle-in-cell charged-particle simulations, plus Monte Carlo collisions with neutral atoms, PIC-MCC IEEE Trans. Plasma Sci., 19 65.
- [7] http://www.egun-igun.com/
- [8] K. Kanno et al., "3D electromagnetic field and electron beam trajectory simulation and analysis considering grid geometry of triode type electron gun", Proceedings of the 4th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 32nd Linear Accelerator Meeting in Japan, Wako, August 1-3, 2007, pp. 691-693.